

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 2 部門第 1 区分  
 【発行日】平成21年6月25日 (2009.6.25)

【公表番号】特表2008-540118(P2008-540118A)  
 【公表日】平成20年11月20日 (2008.11.20)  
 【年通号数】公開・登録公報2008-046  
 【出願番号】特願2008-512395(P2008-512395)  
 【国際特許分類】

**B 0 5 C 5/00 (2006.01)**

【F I】

B 0 5 C 5/00 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成21年5月11日 (2009.5.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

受像基板上にパターンを有する液体層を固着させる液滴塗布装置であって：

液滴放出体；

抵抗ヒーター装置；及び

相対運動を起こす装置；

を有し、

前記液滴放出体は、公称流速 $v_{j0}$ を有する複数の連続した液体流を放出する1次元アレイのノズルへ進むことができる正圧の液体を含み、

前記複数のノズルは、実効ノズル径 $D_0$ を有し、かつ実効ノズル間隔が $L_y$ であるアレイ方向に向かって延び、

前記抵抗ヒーター装置は、前記複数の連続した液体流を所定の公称液滴体積 $V_0$ を有する複数の液滴流に分割させるのに十分な周期 $\tau_0$ の熱エネルギーパルスを、前記の複数のノズルへ進むことができる液体へ送るように備えられ、

前記相対運動を起こす装置は、前記液滴放出体と前記受像基板とを相互に対して、処理方向に処理速度 $S$ で動かすように備えられ、それにより、個々の液滴は、前記受像基板に対して、アドレス指定能力 $A_p = \tau_0 S$ でのアドレス指定が可能となり、

前記実効的ノズル間隔は $85\mu\text{m}$ 未満で、

前記処理速度 $S$ は少なくとも $1\text{m/sec}$ で、

前記処理方向における前記受像基板での個々の液滴の前記アドレス指定能力は、 $6\mu\text{m}$ 未満である、

液滴塗布装置。

【請求項 2】

前記公称流速が、少なくとも $10\text{m/sec}$ で、かつ $20\text{m/sec}$ 未満である、つまり $10\text{m/sec} < v_{j0} < 20\text{m/sec}$ である、請求項1に記載の液滴塗布装置。

【請求項 3】

前記実効ノズル直径が、 $6\mu\text{m}$ よりも長く、かつ $13\mu\text{m}$ よりも短い、つまり $6\mu\text{m} < D_0 < 13\mu\text{m}$ である、請求項1に記載の液滴塗布装置。